

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年10月8日(08.10.2020)



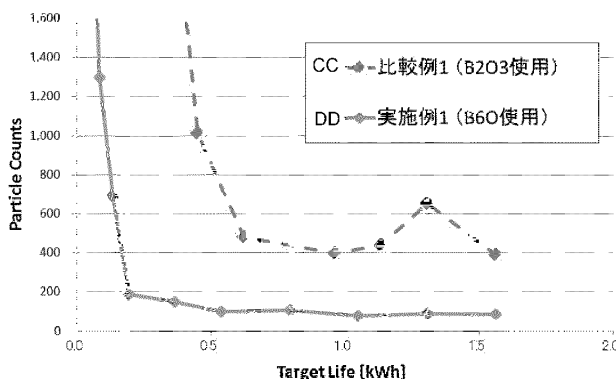
(10) 国際公開番号

WO 2020/202604 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) C22C 5/04 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01) C22C 19/07 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01) C22C 30/00 (2006.01)
C22C 1/05 (2006.01) C22C 32/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/037143
- (22) 国際出願日: 2019年9月20日(20.09.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-069393 2019年3月29日(29.03.2019) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP];
〒1008164 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 古谷 祐樹(FURUYA, Yuki); 〒3191535
茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X
金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: アクシス国際特許業務法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイマークビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: SPUTTERING TARGET AND METHOD FOR MANUFACTURING SPUTTERING TARGET

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット及びスパッタリングターゲットの製造方法



CC Comparative Example 1 (using B2O3)
DD Example 1 (using B6O)

(57) Abstract: Provided are a sputtering target in which the occurrence of particles can be reduced, and which has improved uniformity, and a method for manufacturing the sputtering target. The present invention provides a sputtering target characterized by including 10 mol% to 85 mol% Co, 0 mol% to 47 mol% Pt, and 0 mol% to 47 mol% Cr as metal components, and by including at least B₆O as an oxide component.

(57) 要約: パーティクルの発生を低減でき、より均質なスパッタリングターゲット及びその製造方法を提供する。金属成分としてCoを10mol%以上85mol%以下、Ptを0mol%以上47mol%以下、Crを0mol%以上47mol%以下含み、酸化物成分として少なくともB₆Oを含むことを特徴とするスパッタリングターゲットである。

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))